

## 高真空蒸着装置RD-1600



高真空蒸着装置RD-1600は有機物専用蒸着装置で、有機セルを4ヶ搭載しております。

また、2ヶ同時成膜も可能です。

L/L室が付属されておりますので、成膜室を高真空状態に保持したまま基板の交換が可能です。

基板加熱はハロゲンランプを採用し300°Cまで昇温可能です。

排気系は自動動作。成膜制御も有機セルと水晶振動式膜厚計の連動により膜厚レートの制御を自動的に行います。

### 高真空蒸着装置RD-1600仕様

- 到達圧力       $\times 10^{-5}$ Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 排気速度      大気圧から60分で $1.2 \times 10^{-4}$ Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 真空室径      内寸:  $\phi 580\text{mm} \times 625\text{mmH}$  SUS304 電解研磨処理 前扉方式
- 蒸着機構      有機セル:K熱電対による温度制御  
有機セル数:4対(最大2源同時可能)
- 基板形状       $\square 200\text{mm}$ 以内
- 基板回転      回転数:0~20rpm
- 基板加熱      最高温度:300°C(基板表面上)
- 膜厚計      水晶振動式膜厚計
- 真空排気系      油回転ポンプ:403L/min[60Hz]  
ターボ分子ポンプ:480L/sec
- 真空計      広帯域真空計
- 操作方法      排気系全自動(手動操作も可能)/成膜系全自動(手動操作も可能)
- 制御系      独立制御盤型:タッチパネル/シーケンサー/サイリスタユニット/各種コントローラ
- ユーティリティ      電 気:AC200V三相5.0kVA  
計装エア:圧力0.5MPa以上  
乾燥窒素:圧力0.05MPa以上0.1MPa以下
- 装置寸法      装置本体:2,472W  $\times$  1,200D  $\times$  (1,929)H(mm)  
制 御 盤:570W  $\times$  1000D  $\times$  (1,913)H(mm)